

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成24年8月9日(2012.8.9)

【公開番号】特開2011-9309(P2011-9309A)
 【公開日】平成23年1月13日(2011.1.13)
 【年通号数】公開・登録公報2011-002
 【出願番号】特願2009-149175(P2009-149175)
 【国際特許分類】

H 0 1 L 21/027 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/30 5 2 5 W

H 0 1 L 21/30 5 0 2 M

H 0 1 L 21/30 5 1 4 E

H 0 1 L 21/30 5 2 0 Z

【手続補正書】

【提出日】平成24年6月22日(2012.6.22)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基板に形成されているマークの位置を設定されている検出条件に従って検出し、その検出結果に従って該基板を露光する処理を行う複数の露光装置を含む露光システムであって、

前記複数の露光装置におけるいずれか 1 つの露光装置においてエラーが発生したことに
 応じて前記いずれか 1 つの露光装置において特定プロセスのための検出条件が変更された
 ときに前記複数の露光装置における他の露光装置が前記特定プロセスのための複数の基板
 からなるロットを処理中である場合に、該ロットにおける処理中の基板のマークの位置の
 検出処理の終了後であって次の基板のマークの位置の検出処理の開始前に、当該変更の後
 の検出条件に応じて前記他の露光装置における検出条件を設定する制御部を備えることを
 特徴とする露光システム。

【請求項 2】

前記検出条件は、マークの位置を検出するための信号処理における条件、計測すべきマ
 ークの座標、および、マークを照明する照明条件の少なくとも 1 つを含む、
 ことを特徴とする請求項 1 に記載の露光システム。

【請求項 3】

前記複数の露光装置が 1 つの筐体に収められていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に
 記載の露光システム。

【請求項 4】

基板を搬送する搬送機構を更に備え、
 前記搬送機構は、前記複数の露光装置において共用される、
 ことを特徴とする請求項 3 に記載の露光システム。

【請求項 5】

基板に形成されているマークの位置を設定されている検出条件に従って検出し、その検
 出結果に従って該基板を露光する処理を行う複数の露光装置を制御する制御装置であって、

前記複数の露光装置におけるいずれか1つの露光装置においてエラーが発生したことに
応じて前記いずれか1つの露光装置において特定プロセスのための検出条件が変更された
されたときに前記複数の露光装置における他の露光装置が前記特定プロセスのための複数の
の基板からなるロットを処理中である場合に、該ロットにおける処理中の基板のマークの
位置の検出処理の終了後であって次の基板のマークの位置の検出処理の開始前に、当該変
更の後の検出条件に応じて前記他の露光装置における検出条件を設定することを特徴とす
る制御装置。

【請求項6】

デバイスを製造するデバイス製造方法であって、
請求項1乃至4のいずれか1項に記載の露光システムによって基板を露光する工程と、
前記工程で露光された基板を現像する工程と、
を含むことを特徴とするデバイス製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

本発明の1つの側面は、基板に形成されているマークの位置を設定されている検出条件
に従って検出し、その検出結果に従って該基板を露光する処理を行う複数の露光装置を含
む露光システムに係り、前記露光システムは、前記複数の露光装置におけるいずれか1つ
の露光装置においてエラーが発生したことに応じて前記いずれか1つの露光装置において
特定プロセスのための検出条件が変更されたときに前記複数の露光装置における他の露光
装置が前記特定プロセスのための複数の基板からなるロットを処理中である場合に、該ロ
ットにおける処理中の基板のマークの位置の検出処理の終了後であって次の基板のマーク
の位置の検出処理の開始前に、当該変更の後の検出条件に応じて前記他の露光装置におけ
る検出条件を設定する制御部を備える。